

07.01.03

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

REC'D 2 4 JAN 2003
WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 1月 8日

出願番号 Application Number:

特願2002-001831

[ST.10/C]:

[JP2002-001831]

出 願 人 Applicant(s):

東京エレクトロン株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2002年11月22日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

JPP012193

【あて先】

特許庁長官 及川 耕造

【国際特許分類】

H01L 21/68

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBS放送センター東

京エレクトロン株式会社内

【氏名】

広木 勤

【特許出願人】

【識別番号】

000219967

【氏名又は名称】

東京エレクトロン株式会社

【代表者】

東哲郎

【代理人】

【識別番号】

100090125

【弁理士】

【氏名又は名称】

浅井 章弘

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

049906

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9105400

【プルーフの要否】



【書類名】 明細書

【発明の名称】 搬送機構、処理システム及び搬送方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 被処理体に対して所定の処理を施す処理装置へ前記被処理体を搬送するための搬送機構において、

搬送基台と、

前記搬送基台上に、実質的に同一平面上で且つ実質的に同一方向へ出没できるようにスライド可能に設けられると共に、先端部で前記被処理体を保持する複数の保持アーム部と、

を備えたことを特徴とする搬送機構。

【請求項2】 前記搬送基台を支持して屈伸可能になされた屈伸アーム部を有することを特徴とする請求項1記載の搬送機構。

【請求項3】 前記搬送基台は、前記屈伸アーム部に対して旋回移動可能になされていることを特徴とする請求項2記載の搬送機構。

【請求項4】 被処理体に対して所定の処理を施す処理装置へ前記被処理体を搬送するための搬送機構において、

直線移動可能になされた移動台と、

前記移動台に連結軸を介して支持された搬送基台と、

前記搬送基台上に、実質的に同一平面上で且つ実質的に同一方向へ出没できるようにスライド可能に設けられると共に、先端部で前記被処理体を保持する複数の保持アーム部と、

を備えたことを特徴とする搬送機構。

【請求項5】 前記移動台と前記搬送基台は、前記連結軸の移動を許容する細溝を介して互いに異なる部屋に収容されていることを特徴とする請求項4記載の搬送機構。

【請求項6】 前記部屋を区画するケーシングの外部に設けた複数の駆動モータ 部と、

前記複数の駆動モータ部の各駆動力を前記搬送基台の旋回力及び前記保持アー



ム部の駆動力として伝達するために前記移動台及び前記搬送基台に設けられた第 1の歯車機構及び第2の歯車機構と、

を備えたことを特徴とする請求項4または5記載の搬送機構。

【請求項7】 前記連結軸は、互いに自由回転が可能になされた3軸同軸構造になされていることを特徴とする請求項6記載の搬送機構。

【請求項8】 前記ケーシング内には、前記複数の駆動モータ部によって回転されると共にその長手方向に沿ってスライド溝が形成された複数のスプライン軸が設けられることを特徴とする請求項6または7記載の搬送機構。

【請求項9】 前記保持アーム部は、実質的な円弧に沿って実質的に同一方向へ 出没できるようになされていることを特徴とする請求項1万至8のいずれかに記載の搬送機構。

【請求項10】 前記複数の保持アーム部は、互いに平行に配置されていることを特徴とする請求項1万至8のいずれかに記載の搬送機構。

【請求項11】 前記複数の保持アーム部は、それぞれの延出方向が交差するように前記保持アーム部の先端側が互いに接近するように配置されていることを特徴とする請求項1万至8のいずれかに記載の搬送機構。

【請求項12】 前記複数の保持アーム部は、それぞれの延出方向が拡開するように前記保持アーム部の先端側が互いに遠ざかるように配置されていることを特徴とする請求項1万至8のいずれかに記載の搬送機構。

【請求項13】 前記搬送基台には、前記保持アーム部の駆動力を発生するため に密閉ケース内に収容したアーム駆動モータ部が設けられることを特徴とする請 求項1乃至5及び9乃至12のいずれかに記載の搬送機構。

【請求項14】 前記搬送基台には、前記搬送基台の旋回駆動力を発生するため に密閉ケース内に収容した旋回駆動モータ部が設けられることを特徴とする請求 項1乃至5及び9乃至13のいずれかに記載の搬送機構。

【請求項15】 被処理体に所定の処理を施すための複数の処理装置と、

周囲に前記複数の処理装置を連結した共通搬送室と、

前記共通搬送室内に設けられた請求項1万至14のいずれかに記載の搬送機構 と、



を備えたことを特徴とする処理システム。

【請求項16】 前記共通搬送室には、真空引き可能になされたロードロック室 が連結されると共に、前記共通搬送室内は真空状態に保持されていることを特徴 とする請求項15記載の処理システム。

【請求項17】 請求項1乃至14のいずれかに記載の搬送機構を用いて被処理 体の搬送を行う搬送方法において、

前記搬送基台の直線移動または旋回移動と前記保持アーム部のスライド移動と を同時に行うようにしたことを特徴とする搬送方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体ウエハ等の被処理体の搬送機構、処理システム及び搬送方法に関する。

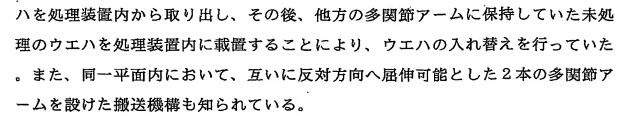
[0002]

【従来の技術】

一般に、半導体集積回路を製造するためにはウエハに対して成膜、エッチング、酸化、拡散等の各種の処理が行なわれる。そして、半導体集積回路の微細化及び高集積化によって、スループット及び歩留りを向上させるために、同一処理を行なう複数の処理装置、或いは異なる処理を行なう複数の処理装置を、共通の搬送室を介して相互に結合して、ウエハを大気に晒すことなく各種工程の連続処理を可能とした、いわゆるクラスタ化された処理システム装置が、例えば特開平3-19252号公報、特開2000-208589号公報や特開2000-299367号公報等に開示されているように、すでに知られている。また、これに関連する発明として、本出願人は特願2001-60968を出願している。

[0003]

この場合、特に、処理装置に対して直接的にアクセスして処理済みのウエハと 未処理のウエハとを入れ替えるために、共通の搬送室には、屈伸、旋回及び昇降 が自在になされた例えばフログレッグ型の2本の多関節アームを上下2段に設け た搬送機構を配置しており、そして、一方の空の多関節アームで処理済みのウエ



[0004]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、上述のような搬送機構にあっては、アームの屈伸運動や旋回運動の動作を主体としているため、位置決めの精度や繰り返し位置決め精度、或いは信頼性やメンテナンス性に関してやや改良の余地があった。また、特開平10-50804号公報では、ウエハ保持部がリニアトラック上を移動する搬送ロボットを開示するが、この搬送ロボットにはスループットの点で問題があった。

本発明は、以上のような問題点に着目し、これを有効に解決すべく創案された ものである。本発明の目的は、屈伸運動や旋回運動を極力排除して、位置決め精 度や繰り返し位置決め精度やスループット等を向上させることが可能な搬送機構 、処理システム及び搬送方法を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】

請求項1に係る発明は、被処理体に対して所定の処理を施す処理装置へ前記被処理体を搬送するための搬送機構において、搬送基台と、前記搬送基台上に、実質的に同一平面上で且つ実質的に同一方向へ出没できるようにスライド可能に設けられると共に、先端部で前記被処理体を保持する複数の保持アーム部と、を備えたことを特徴とする搬送機構である。

これにより、搬送基台に対して保持アーム部を直線的にスライド移動させることにより、被処理体の入れ替えを行うことが可能なので、位置決め精度や繰り返し位置決め精度を向上できるのみならず、構成が比較的簡単なことから信頼性やメンテナンス性も向上させることができる。

[0006]

この場合、例えば請求項2に規定するように、前記搬送基台を支持して屈伸可能になされた屈伸アーム部を有する。



また、この場合、例えば請求項3に規定するように、前記搬送基台は、前記屈伸アーム部に対して旋回移動可能になされている。

また、請求項4に係る発明は、被処理体に対して所定の処理を施す処理装置へ前記被処理体を搬送するための搬送機構において、直線移動可能になされた移動台と、前記移動台に連結軸を介して支持された搬送基台と、前記搬送基台上に、実質的に同一平面上で且つ実質的に同一方向へ出没できるようにスライド可能に設けられると共に、先端部で前記被処理体を保持する複数の保持アーム部と、を備えたことを特徴とする搬送機構である。

[0007]

また、例えば請求項5に規定するように、前記移動台と前記搬送基台は、前記 連結軸の移動を許容する細溝を介して互いに異なる部屋に収容されている。

これによれば、パーティクルを発生する頻度の高い移動台を収容している部屋 の雰囲気が、搬送基台を収容している部屋に流入することを抑制することが可能 となる。

[0008]

また、例えば請求項6に規定するように、前記部屋を区画するケーシングの外部に設けた複数の駆動モータ部と、前記複数の駆動モータ部の各駆動力を前記搬送基台の旋回力及び前記保持アーム部の駆動力として伝達するために前記移動台及び前記搬送基台に設けられた第1の歯車機構及び第2の歯車機構と、を備えるように構成してもよい。

これによれば、駆動モータ部をケーシングの外側に配置し、この駆動力を歯車 機構によって伝達して保持アーム部をスライド移動させることが可能となる。

この場合、例えば請求項7に規定するように、前記連結軸は、互いに自由回転 が可能になされた3軸同軸構造になされている。

[0009]

また、例えば請求項8に規定するように、前記ケーシング内には、前記複数の 駆動モータ部によって回転されると共にその長手方向に沿ってスライド溝が形成 された複数のスプライン軸が設けられる。

また、例えば請求項9に規定するように、前記保持アーム部は、実質的な円弧



に沿って実質的に同一方向へ出没できるようになされていてもよい。

また、例えば請求項10に規定するように、前記複数の保持アーム部は、互い に平行に配置されている。

また、例えば請求項11に規定するように、前記複数の保持アーム部は、それ ぞれの延出方向が交差するように前記保持アーム部の先端側が互いに接近するよ うに配置されているようにしてもよい。

[0010]

また、例えば請求項12に規定するように、前記複数の保持アーム部は、それ ぞれの延出方向が拡開するように前記保持アーム部の先端側が互いに遠ざかるよ うに配置されているようにしてもよい。

また、例えば請求項13に規定するように、前記搬送基台には、前記保持アーム部の駆動力を発生するために密閉ケース内に収容したアーム駆動モータ部が設けられるようにしてもよい。

また、例えば請求項14に規定するように、前記搬送基台には、前記搬送基台 の旋回駆動力を発生するために密閉ケース内に収容した旋回駆動モータ部が設け られるようにしてもよい。

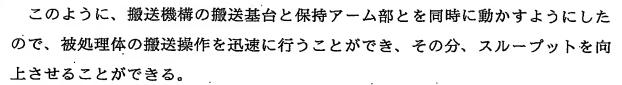
[0011]

また、例えば請求項15に係る発明は、被処理体に所定の処理を施すための複数の処理装置と、周囲に前記複数の処理装置を連結した共通搬送室と、前記共通搬送室内に設けられた請求項1乃至14のいずれかに記載の搬送機構と、を備えたことを特徴とする処理システムである。

この場合、例えば請求項16に規定するように、前記共通搬送室には、真空引き可能になされたロードロック室が連結されると共に、前記共通搬送室内は真空 状態に保持されている。

[0012]

また、請求項17に係る発明は、上記搬送機構を用いて行われる方法発明を規定したものであり、すなわち、上記した搬送機構を用いて被処理体の搬送を行う搬送方法において、前記搬送基台の直線移動または旋回移動と前記保持アーム部のスライド移動とを同時に行うようにしたことを特徴とする搬送方法ある。



[0013]

【発明の実施の形態】

以下に、本発明に係る被処理体の搬送機構、処理システム及び搬送方法の一実 施例を添付図面に基づいて詳述する。

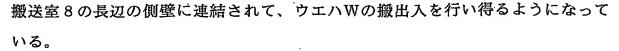
<第1の実施例>

図1は本発明の搬送機構の第1の実施例を用いた処理システムの一例を示す概略構成図、図2は搬送機構の第1の実施例を示す拡大斜視図、図3は搬送機構の第1の実施例を示す内部構成図、図4は搬送送機構の第1の実施例の動作の一例を示す図である。

図1に示すように、この処理システム2は、入口側搬送系4と処理システム本体6とより主に構成される。上記入口側搬送系4は、縦長に成形された入口側搬送室8を有しており、この一側には、被処理体としての半導体ウエハWを複数枚収容できるカセット容器を設置する入口ポート10が複数、例えば図示例では3個設けられている。そして、この入口側搬送室8内には、その長手方向に沿って移動可能になされた例えば2つのピックを有する多関節アーム機構12が設けられており、上記ピックによりウエハWを保持してこれを搬送できるようになっている。また、この入口側搬送室8の一端部には、ウエハWのノッチやオリエンテーションフラットを認識してこの位置決めを行う位置決め装置14が設けられる

[0014]

一方、上記処理システム本体 6 は、横長箱状に成形されたケーシング 1 8 により密閉状態に区画された共通搬送室 1 6 を有しており、この周囲には、ゲートバルブ G を介して連結された複数、図示例では 6 個の処理装置 2 0 A ~ 2 0 F が設けられると共に、同じくゲートバルブ G を介して真空引きと大気圧復帰が可能になされた 2 つのロードロック室 2 2 A、2 2 B が連結して設けられている。このロードロック室 2 2 A、2 2 B は、それぞれゲートバルブ G を介して上記入口側



また、この共通搬送室16の一部には、冷却機能や予熱機能を有して一時的にウエハWを載置する複数、例えば2つのバッファ台24A、24Bが設けられている。この共通搬送室16は、真空引き及びN₂ ガス供給可能になされており、真空状態に維持されている。そして、この共通搬送室16内に、本発明の特徴とする第1の実施例の搬送機構26が設置されている。

[0015]

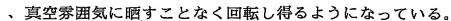
この搬送機構26は、上記共通搬送室16内の中央部にその支点を旋回自在にして設けた多関節の屈伸アーム部28と、この屈伸アーム部28の先端部に回転乃至旋回自在に設けた搬送基台30と、この搬送基台30にスライド移動可能に設けた複数、図示例では2つの保持アーム部32A、32Bとにより主に構成されている。

具体的には、上記屈伸アーム部28は、良く知られたタイミングベル等を用いて"く"の字状に屈曲可能になっており、また、この屈伸アーム部28の屈曲部及び旋回部には磁気シール等が介在されて内部は密閉状態となっている。

また、図2及び図3にも示すように、搬送基台30は、底板30Aと、天井板30Bと、その周囲に設けた側板30Cとよりなり、内部が空間状態になっている。尚、図3においては、天井板30Bと側板30Cの記載は省略している。

[0016]

そして、この底板30A上に、2個のアーム駆動モータ部36A、36Bと、その中央に基台駆動モータ部36Cとが設けられている。各モータ部36A~36Cは、密閉ボックス38A~38C内にそれぞれ例えばステップモータよりなる電動モータ39A~39Cを収容しており、各密閉ボックス38A~38Cには、内部に電源ケーブルが挿通された蛇腹状のステンレス管やテフロン(登録商標)管等よりなる可撓性のある密閉式フレキシブル管40が、気密に接続されている。このフレキシブル管40は、底板30Aの中央に設けた貫通孔を介して上記屈伸アーム部28内を通り、外部に引き出されている。そして、上記貫通孔の入口は、気密にシールされている。これにより、各電動モータ39A~39Cを



[0017]

上記アーム駆動モータ部36A、36Bに並設して、互いに平行になされた案内レール42A、42Bが設置されており、この案内レール42A、42Bには、その長手方向に沿って案内溝43A、43Bが形成されている。そして、各案内レール42A、42Bの下部には、上記アーム駆動モータ部36A、36Bの動力によって回転されるボールネジ44A、44Bが並設されている。そして、このボールネジ44A、44Bには、上記案内溝43A、43B内を挿通して上方に突出された移動台46A、46Bが螺合されており、このボールネジ44A、44Bを正逆回転させることにより、上記移動台46A、46Bを前記案内溝43A、43Bに沿って前進及び後退できるようになっている。そして、この移動台46A、46Bに、上記保持アーム部32A、32Bの基端部をネジ止めして固定し、先端部にウエハWを保持し得るようになっている。そして、上記案内レール42A、42Bの各案内溝43A、43Bに対応させて、天井板30Bにも案内溝45A、45B(図2参照)が設けられる。

[0018]

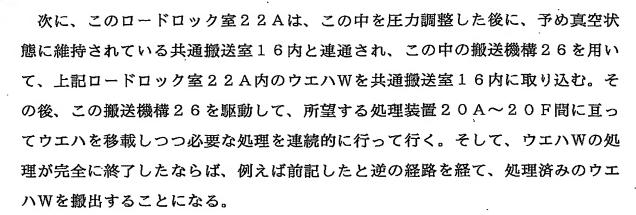
また、上記底板30Aの挿通孔の周囲には、傘歯車48が固設されており、この傘歯車48には、上記基台駆動モータ部36Cの回転軸に設けた傘歯車50が歯合されて、この基台駆動モータ部36Cを正逆回転駆動させることにより、この搬送基台30の全体を左右に回転し得るようになっている。また、各電動モータ部39A~39Cの回転軸の密閉ボックス38A~38Cに対する貫通部には、気密性を保持するための磁気シール(図示せず)が介在されている。

[0019]

次に、以上のように構成された本実施例の動作について説明する。

まず、図1を参照して半導体ウエハWの基本的な流れについて説明する。

まず、入口ポート10に載置されたカセット容器内より未処理の半導体ウエハ Wは、入口側搬送室8内の多関節アーム機構12によって保持されて、位置決め 装置14内で位置決めされた後に、一方のロードロック室、例えばロードロック 室22A内に収容される。



[0020]

ここで、上記搬送機構30の動作について、図4も参照して具体的に説明する。ここでは一例として処理装置20Bに対してウエハWの入れ替えを行う場合を例にとって説明する。

まず、この搬送機構30を所望する処理装置の直前へ移動させるには、この搬送機構30を支持している屈伸アーム部28を適宜屈伸及び旋回させることによって、所望する処理装置の直前へ移動させる。

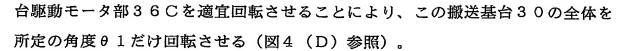
そして、この搬送機構30を所望する処理装置20Bに向けるには、図3に示される基台駆動モータ部36Cを駆動させることにより、この回転軸の傘歯車50が底板34A側の傘歯車48を正回転、或いは逆回転させ、これにより搬送基台30を旋回させてこれを所望する処理装置20Bの搬出入口に向ける(図4(A)参照)。

そして、ウエハWの入れ替えを行うには、例えば保持アーム部32Bが空の場合には、このアーム駆動モータ部36Bを駆動することによりボールネジ44Bを回転し、これにより移動台46Bに固定されている保持アーム部32Bを案内溝43Bに沿って前方へスライド移動させてこれを延在させる。そして、この保持アーム部32Bの先端で処理済みのウエハWを受け取る(図4(B)参照)。

[0021]

次に、上記アーム駆動モータ部36Bを上記とは逆回転させることにより、この保持アーム部32Bを引き戻すように後方へスライド移動し、これによりウエハWを共通搬送室16内に取り込む(図4(C)参照)。

次に、他方の保持アーム部32Aを処理装置20Bの中心に向けるために、基



次に、未処理のウエハWを保持している保持アーム部32Aのアーム駆動モータ部36Aを駆動することによりこの保持アーム部32Aを前方へスライド移動させてこれを延在させる。そして、この保持アーム部32Aの先端のウエハWを処理装置20B内に移載する(図4(E)参照)。そして、この駆動モータ部36Bを上記とは逆回転させることにより保持アーム部32Bを引き戻すように後方へスライド移動し(図4(F)参照)、これによりウエハWの入れ替え操作を完了することになる。また、保持アーム部32A、32Bが同一方向にスライド可能となっているので、搬送基台30を僅かに回転させるだけでウエハWの入れ替えを行うことができ、スループットが向上する。

[0022]

このように、本実施例では搬送基台30に対して保持アーム部32A、32B を直線的にスライド移動させることにより、半導体ウエハWの入れ替えを行うことが可能なので、位置決め精度や繰り返し位置決め精度を向上できるのみならず、構成が比較的簡単なことから、信頼性やメンテナンス性も向上させることができる。

また、各電動モータ39A~39Cを、密閉ボックス38A~38Cにり密閉 状態で囲み込むようにしたので、各電動モータ39A~39Cより発生するパー ティクルがウエハWに付着することも防止することができる。

尚、図4に示すウエハ入れ替えの場合には、搬送基台30の全体を途中で角度 θ1だけ回転させて保持アーム部32A、32Bの向きを変えるようにして、ウ エハWの入れ替えを行ったが、搬送基台30の回転移動ではなくて、直線移動を 行ってウエハの入れ替えを行うようにしてもよい。

[0023]

図5は半導体ウエハWの入れ替え操作の第1の変形例の一部を示す図である。

図4に示す場合には、処理装置20Bに対して搬送基台30をある程度の角度だけ傾けて停止させているが、図5に示す場合には、処理装置20Bに対して搬送基台30を傾けることなく直線状となるように停止させている。



まず、空の保持アーム部32Bで処理装置20B内の処理済みウエハWを保持したならば(図5(A)参照)、次に、この保持アーム部32Bを引き戻してウエハWを共通搬送室16内側へ取り込む(図5(B)参照)。

[0024]

次に、この搬送基台30の全体を、図5(C)に示すように距離L1だけ水平移動し、他方の未処理のウエハWを保持している保持アーム部32Aを処理装置20Bの搬出入口に位置させる。以後は、この保持アーム部32Aを前述したと同様にスライド移動させることにより、ウエハWの入れ替えを行うことができる。上記搬送基台30の水平移動は、図1に示す屈伸アーム部28を水平距離がL1となるように屈伸させればよく、この際、搬送基台30が常時同一方向を向いているように、図3に示す基台駆動モータ部36Cも同時に僅かに回転駆動して、屈伸アーム部28の屈伸に伴って発生する搬送基台30自体の回転を相殺する

また、図5に示すウエハ入れ替えの場合には、保持アーム部32Bのスライド移動と、搬送基台30の水平移動とを別々のステップに分けて行ったが、両者の移動を同時に行ってもよい。図6はこのような半導体ウエハの入り変え操作の第2の変形例の一部を示す図である。ここでは、図6(A)に示すように保持アーム部32Bで処理済みのウエハWを保持したならば、図6(B)に示すように、この保持アーム部32Bを引き戻しつつ、これと同時に搬送基台30を水平移動させて、図6(C)に示すように位置させる。

[0025]

これによれば、保持アーム部32Bのスライド移動と搬送基台30の水平移動とを同時に行うようにしたので、その分、入れ替え操作に要する時間を節約することができ、スループットを向上させることができる。

また、図4の態様では、保持アーム部32A、32Bのスライド移動と搬送基台30の旋回移動とを同時に行わせれば、上述したと同様な効果を得ることができる。

また、図3に示す場合には、案内レール42A、42Bとボールネジ44A、 44Bとをそれぞれ上下に並設したが、これに限定されず、これらを水平に並設



図7はこのような支持アーム部の駆動系の変形例の一部を示す斜視図である。 ここでは両案内レール部42A、42B及びこの近傍の構造は同じなので、図7 においては、案内レール部42Aを例にとって説明する。また、図3に示す構成 部分と同一部分については同一符号を付してその説明を省略する。

[0026]

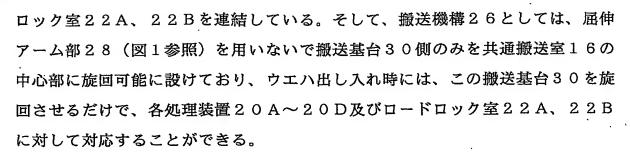
図7に示すように、ここでは案内レール部42Aには案内溝43A(図3参照)を設けておらず、この案内レール部42Aは断面矩形状に成形されている。そして、上記案内レール部42Aを跨いで、この案内レール部42Aに沿ってスライド移動可能に移動台46Aが設けられている。そして、この移動台46Aから水平方向にボールネジ取付片52が延びており、このボールネジ取付片52に、上記案内レール42Aに平行となるようにボールネジ44Aの基端部を回転自在に取り付けている。そして、アーム駆動モータ部36Aの密閉ボックス38A内に収容された電動モータ39Aの回転軸54は、磁気シール56を介して外側へ貫通して取り出されている。そして、この回転軸54は、カップリング58により上記ボールネジ44Aの基端部に連結されており、このボールネジ44Aを正逆回転し得るようになっている。尚、フレキシブル管40は、シール部材57を介して底板30Aを貫通させるように設けてもよい。

[0027]

このような構造の場合にも、上記アーム駆動モータ部36Aを駆動することにより、保持アーム部32Aを直線状にスライド移動させて、これを前方へ出没させることができる。

図1では、共通搬送室16は横長に形成されており、これに全体で6個の処理 装置20A~20Fを連結した場合を例にとって説明したが、処理装置の数が少なくて、例えば4個の場合には、共通搬送室16の形状を略正六角形状としてもよい。図8はこのような略正六角形状の共通搬送室を有する処理システムの一例を示す概略平面図である。

この場合には、図8に示すように、略正六角形状の共通搬送室16の周囲に、4つの処理装置、例えば処理装置20A~20Dを連結すると共に2つのロード



[0028]

<第2実施例>

次に、第2の実施例について説明する。

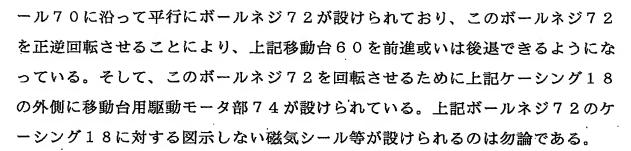
図1に示す処理システムにあっては、搬送機構26の屈伸アーム部28を屈伸させることによって搬送基台30を共通搬送室16内の長手方向に移動させたが、この屈伸アーム部26を用いないで、他の手段、例えばボールネジ機構を用いて搬送基台30を移動させるようにしてもよい。図9はこのような搬送機構の第2の実施例を用いた処理システムの一例を示す概略構成図であり、ここではボールネジ機構を用いて搬送基台を移動させるようにしている。

図10は搬送基台と移動台との取り付け状態を示す図、図11は半導体ウエハの入れ替え操作時の動作を示す図である。尚、先に説明した部分と同一構成部分については同一符号を付して説明を省略する。

[0029]

図10及び図11に示すように、この搬送機構26では、搬送基台30(図3参照)は、図1に示す屈伸アーム部28に代えて、直線移動可能になされた移動台60に、中空の連結軸62を介して取り付けられている。そして、上記搬送基台30は、この連結軸62に対して回転可能に支持されている。図3中に示されるフレキシブル管40は、上記中空の連結軸62の内部に挿通されている。

また、共通搬送室16内を区画するケーシング18内は、上記連結軸62の移動を許容するための細溝64がその長手方向に沿って形成された仕切板66によって、上下の2つの空間68A、68Bに区画されている。従って、下側の空間68Bに上記移動台60が配置され、上側の空間68Aに上記搬送基台30が配置されることになる。そして、下側の空間68Bには、その長手方向に沿って上記移動台60を案内するための案内レール70が設けられると共に、この案内レ



[0030]

そして、図11に示すように上記上側の空間68Aの側壁には、これに不活性ガス、又はN2ガスを導入するガスノズル76が設けられると共に、下側の空間68Bの底部には、内部雰囲気を真空引きする排気口78が設けられており、上側の空間68A内の雰囲気ガスが細溝64を介して下側の空間68Bに流れ込んで排気されるようになっている。

この実施例によれば、移動台60に螺合されているボールネジ72を回転させることにより、連結軸62を介して移動台60と一体的に連結されている搬送基台30を共通搬送室30内の長手方向に沿って移動させることができる。

本実施例の場合には、図1に示したような屈伸アーム部28を用いないで、ボールネジ機構によって搬送基台30を直線状に移動させるようにしたので、位置決め精度や繰り返し位置決め精度を更に向上させることが可能となる。また、ボールネジ機構の構造も簡単なので、信頼性やメンテナンス性も更に向上させることが可能となる。尚、搬送基台30を直線状に移動させる機構としてリニアモータ等を使用してもよい。

[0031]

<第3実施例>

次に、第3の実施例について説明する。

今まで説明した装置例の場合には、図3に示すように、保持アーム部32A、32Bのスライド移動及び搬送基台30の回転移動は、この近傍に設けたアーム駆動モータ部36A、36B及び基台駆動モータ部36Cからの駆動力によって行ったが、これらの各モータ部36A~36Cを共通搬送室の外側に設け、これらモータ部36A~36Cの駆動力を歯車機構によって伝達させるようにしてもよい。図12はこのような搬送機構の第3の実施例を示す分解斜視図、図13は

歯車機構の連結状態を模式的に示す図、図14はスプライン軸と歯車との関係の 一例を示す図である。尚、図12では、搬送基台の天井板の記載を省略している

この第3実施例では、図10にて説明した第2の実施例の構造を基本軸として 用いており、移動台60の移動を移動台用駆動モータ部74により行うようになっている。

[0032]

まず、上述したように、上記保持アーム部32A、32B及び搬送基台30をそれぞれ移動させるアーム駆動モータ部36A、36B及び基台駆動モータ府36Cは、図12に示すように共通搬送室16を区画するケーシング18の側壁に設けられている。そして、各駆動モータ部36A~36Cからの駆動力を伝達するために移動台60内には第1の歯車機構80が設けられ、また、モータ部36A、36Bからの駆動力を伝達するために搬送基台30内には第2の歯車機構82が設けられる。

具体的には、上記各駆動モータ部36A~36Cには、上記移動台60の移動方向に沿って延びるように配置された3本のスプライン軸84A~84Cがそれぞれ連結されている。そして、各スプライン軸84A~84Cは、上記移動台60を貫通している。また、各スプライン軸84A~84Cのケーシング18に対する貫通部には、前述したと同様に磁気シール(図示せず)等を介在させてケーシング18内の気密性を保持している。

[0033]

各スプライン軸84A~84Cには、図14に代表としてスプライン軸84Aに示されるように、その長手方向に沿って延びる溝86が形成されている。この各スプライン軸84A~84Cには、上記溝86に嵌まり込んで、回転方向に対しては規制されると共に、スプライン軸84A~84Cの長手方向に対してはスライド可能になされたボス側歯車88A~88Cが嵌め込まれている(図12参照)。これらの各ボス側歯車88A~88Cは、移動台60に回転自在に支持されており、従って、この各ボス側歯車88A~88Cは移動台60と一体的に移動することになる。



[0034]

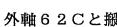
一方、上記移動台60内に収容されている第1の歯車機構80は、図13にも示すように、中心に位置する中軸80Aと、その外側に位置する中間軸80Bと、外軸80Cとによりなされた3軸同軸構造を有しており、軸80A、80B間及び軸80B、80C間にはそれぞれ軸受90が介在されて、互いに回転自在になされている。また、この外軸80Cは移動台60側に回転自在に支持されている。

そして、上記各軸80A~80Cの一端部には、歯車92A、92B、92Cがそれぞれ取り付け固定されると共に、上記各歯車92A~92Cは、前記スプライン軸84A~84Cにスライド可能に嵌め込まれているボス側歯車88A~88Cにそれぞれ歯合されている。従って、上記ボス側歯車88A~88Cが回転することにより、各歯車92A~92Cが従動される。また、上記各軸80A~80Cの他端部には、例えば傘歯車よりなる歯車94A、94B、94Cが取り付け固定されている。

[0035]

一方、上記移動台60に起立して設けられる連結軸62は、図13にも示すように、中心に位置する中軸62Aと、その外側に位置する中間軸62Bと、外軸62Cとによりなされた3軸同軸構造になされており、軸62A、62B間及び軸62B、62C間にはそれぞれ軸受96が介在されて、互いに回転自在になされている。また、この外軸62Cは移動台60の天井板98に軸受100を介して回転自在に支持されている。

そして、上記各軸62A~62Cの下端部には、例えば傘歯車よりなる歯車102A、102B、102Cがそれぞれ取り付け固定されると共に、上記各歯車102A~102Cは、前記第1の歯車機構80の各歯車94A~94Cにそれぞれ歯合されている。従って、上記第1の歯車機構80の各歯車94A~94Cが回転することにより、各歯車102A~102Cが従動される。また、上記3つの各軸62A~62Cの内の内側の2つの軸62A、62Bの上端部には、例えば傘歯車よりなる歯車104A、104Bが取り付け固定されていると共に、外軸62Cの上端は上記搬送基台30の底板30Aに直接的に固定されており、



[0036]

外軸62Cと搬送基台30とが一体的に回転できるようになっている。

一方、上記搬送基台30内に設けられる第2の歯車機構82は、図13にも示 すように、中心に位置する中軸82Aと、その外周に位置する外軸82Bとより なる2軸同軸構造になされており、軸82A、82B間には軸受108が介在さ れて互いに回転自在になされている。また、この外軸82Bは搬送基台30側に 回転自在に支持されている。

そして、上記各軸82A、82Bの一端部には、例えば傘歯車よりなる歯車1 10A、110Bが取り付け固定されると共に、上記各歯車110A、110B は、上記連結軸62の上端部の歯車104A、104Bにそれぞれ歯合されて、 それぞれ独立して回転力を伝達し得るようになっている。また、上記各軸82A 、82Bの他端には、歯車112A、112Bがそれぞれ取り付け固定されてい る。

[0037]

そして、図12へ戻って、2つの保持アーム部32A、32Bに並設される各 ボールネジ44A、44Bの基端部には、歯車114A、114Bが取り付け固 定されると共に、これらの各歯車114A、114Bが上記第2の歯車機構82 の歯車112A、112Bにそれぞれ歯合されることになる。

このような構成において、移動台用駆動モータ部74を駆動することによりボ ールネジ72が回転して移動台60と搬送基台30とが一体的に直線移動するの は、前述した第2の実施例の場合と同じである。

そして、搬送基台30を旋回させるためには、基台駆動モータ部36Cを駆動 する。これにより、この回転駆動力は、スプライン84C及びボス側歯車88C を介して第1の歯車機構80の歯車92Cへ伝達される。

[0038]

この歯車92Cは、外軸80Cと他端部の歯車94Cを一体的に回転し、この 回転力は連結軸62の下端部の歯車102Cへ伝達されてこの外軸62Cの上端 部は搬送基台30に一体的に固定されているので、上記外軸62Cの回転と共に 、この搬送基台30が一体的に回転することになる。

また、保持アーム部32A、或いは32Bをスライド移動させるには、アーム駆動モータ部36A、或いは36Bを回転駆動する。例えば保持アーム部32Aをスライド移動させるには、アーム駆動モータ部36Aを回転駆動すると、この回転駆動力は、スプライン軸84Aを介してボス側歯車88Aに伝達され、更に、第1の歯車機構80の歯車92A、中軸80A及び歯車94Aを介して連結軸62の下端部の歯車102A、中軸62A及び上端部の歯車104へ伝達され、また更に、第2の歯車機構82の一端部の歯車110A、中軸80A及び他端部の歯車112Aへ順次伝達される。そして、この歯車112Aは、ボールネジ44Aの端部の歯車114Aに歯車されているので、この歯車112Aの回転によって上記ボールネジ44Aを正逆回転させて保持アーム部32Aをスライド移動させることができる。他方のボールネジ44Bと保持アーム部32Bに関しても、上述したと同様な動力伝達経路を経て駆動力が伝達されることになる。

[0039]

ここで搬送基台30の旋回時に注意すべきことは、アーム駆動モータ部36A、36Bを停止させた状態で、搬送基台30のみを旋回させると、連結軸62の上端部の歯車104A、104Bが第2の歯車機構82の歯車110A、110Bとがそれぞれ歯合していることから、この搬送基台30の旋回に伴って歯車110A、110Bも回転してしまい、保持アーム部32A、32Bもその回転分だけ延出、或いは縮退することになる。従って、保持アーム部32A、32Bを、搬送基台30に対してスライド移動させることなく、搬送基台30のみを回転させる場合には、上記回転分の延出量、或いは縮退量に見合った分だけ、各アーム駆動モータ部36A、36Bを逆回転させて延出量、或いは縮退量を相殺する

また、本実施例の場合にも、図4~図6にて説明したようなウエハの入れ替え操作を行うことができるのは勿論である。また、図13及び図14に示す歯車機構の内、保持アーム32A、32Bをスライド移動させる部分、及び搬送基台30を旋回させる部分は、図8に示す搬送機構にも適用することができる。

[0040]

以上のように、本実施例では、第1及び第2の実施例と異なり、アーム駆動モ

ータ部36A、36Bと基台駆動モータ部36Cをケーシング18の外側に配置してモータの駆動力は歯車機構80、82と連結軸62とを介して伝達するようにしたので、真空中に駆動源(モータ類)、ガス放出が多く且つ耐熱性に劣るタイミングベルトやハーネス類を入れなくて済むので、真空度を良くできるのみならず、パーティクルが減少し、更には耐熱温度も向上させることができる。また、モータ類を1箇所に集中して集めて配置しているので、これらのモータ類のメンテナンス性が向上できるのみならず、配線作業も容易化でき、例えば図3に示す電源ケーブルを挿通するためのフレキシブル管40を不要にできる。

[0041]

また、以上の各実施例にあっては、搬送基台30上の2本の保持アーム部32 A、32Bは互いに平行に配置されたが、これに限らず、この延出方向が交差するように保持アーム部の先端側が互いに接近するように配置してもよい。

図15はこのような保持アーム部の配列の第1の変形例を示す斜視図、図16 は図15に示す保持アーム部を用いて半導体ウエハの入れ替えを行う場合の工程 を示す図である。

図示例のようにこの実施例の場合には、2つの保持アーム部32A、32Bの 先端側を互いに接近させるようにして配置しており、両保持アーム部32A、3 2Bの延長方向が、処理装置の中心部で交差するようになされている。

[0042]

この実施例の場合には、図16に示すように、例えば処理装置20Bに対して 搬送基台を一旦位置合わせをした後は、空の保持アーム部32Bをスライド移動してこれで処理済みのウエハWを共通搬送室16内へ取り込み(図16(A)~図16(C)参照)、続けて、未処理のウエハWを保持する保持アーム部32Aをスライド移動してこのウエハWを処理装置20B内へ移載すればよい((図16(D)~図16(E)参照)。このように、この実施例では、搬送基台30を固定した状態で、すなわち、図4~図6に示すように搬送基台30を途中で旋回移動したり、水平移動させたりすることなく、ウエハWの入れ替えができるので、その分、入れ替え操作が迅速化されてスループットを向上させることができる



<第4の実施例>

以上の実施例では、各保持アーム部32A、32Bを案内する案内レール42 A、42B(図3参照)を、直線状に成形したが、これに限定されず、この案内 レールを実質的な円弧状に成形してもよい。尚、実質的な円弧状とは、円弧の各 部における曲率が必ずしも同一ではなくともよいことを意味する。

図17は本発明の搬送機構の第4の実施例を示す分解斜視図、図18は図17 に示す保持アーム部を用いて半導体ウエハの入れ替えを行う場合の工程を示す図 である。尚、ここでは、搬送基台30の天井板、基台駆動モータ部及びその関連 部材等の記載は省略している。

[0044]

図示するように、ここでは、両アーム駆動モータ部36A、36B及びボールネジ44A、44Bは中央部に集められ、両モータ部36A、36Bは1つの密閉ボックス116内に収容されている。そして、両ボールネジ44A、44Bの両側に、対称となるように互いに反対方向へ屈曲された略円弧状の案内レール42A、42Bには、これに沿ってスライド移動可能に移動台46A、46Bが取り付けられている。

また、上記ボールネジ44A、44Bには、それぞれ移動コマ118A、118Bが取り付けられると共に、各移動コマ118A、118Bからは、上記各案内レール42A、42Bに向けて、この案内レール42A、42Bの全域をカバーできる長さの案内板120A、120Bが延在させるようにして取り付けられている。そして、各案内板120A、120Bには、その長手方向に沿って延びる案内溝122A、122Bが形成されている。

[0045]

一方、上記各移動台46A、46Bは、各案内レール42A、42Bを跨いでこれと直接接するコマ部材124A、124Bと、このコマ部材124A、124Bより起立された摺動ピン126A、126Bと、この摺動ピン126A、126Bに遊嵌状態で回転自在に嵌装されるリング状のコロ材128A、128Bと、上記摺動ピン126A、126Bの上端にネジ等により取り付け固定される

取付板130A、130Bとにより、それぞれ形成されている。そして、上記摺動ピン126A、126Bが揮通される上記各コロ部材128A、128Bを、それぞれ案内板120A、120Bの各案内溝122A、122Bに嵌め込み、この状態で摺動ピン126A、126Bの上端に各取付板130A、130Bを固定する。そして、各取付板130A、130B上に、各保持アーム部32A、32Bの基端部をそれぞれネジ等により取り付け固定する。ここで、各保持アーム部32A、32Bは、それぞれの対応する案内レール42A、42Bと同様に略円弧状に曲線状に成形するのがよい。

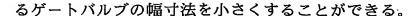
[0046]

この実施例によれば、各ボールネジ44A、44Bが回転するのに従って、案内板120A、120Bが各ボールネジ44A、44Bに沿ってそれぞれ移動する。この時、各移動台46A、46Bは、そのコロ部材128A、128Bが各案内溝122A、122B内で転動することによりこの案内溝122A、122Bの長手方向に沿って移動できるので、結果的に、保持アーム部42A、42Bは、略円弧状の案内レール42A、42Bに沿って略同一方向、すなわち、同一の処理装置に向けてスライド移動することができる。

この実施例の場合には、図18に示すように、例えば処理装置20Bに対して 搬送基台を一旦位置合わせをした後は、空の保持アーム部32Bをスライド移動してこれで処理済みのウエハWを共通搬送室16内へ取り込み(図18(A)~図18(C)参照)、続けて、未処理のウエハWを保持する保持アーム部32Aをスライド移動してこのウエハWを処理装置20B内へ移載すればよい((図18(D)~図18(E)参照)。このように、この実施例では、搬送基台30を 固定した状態で、すなわち、図4~図6に示すように搬送基台30を途中で旋回移動したり、水平移動させたりすることなく、ウエハWの入れ替えができるので、その分、入れ替え操作が迅速化されてスループットを向上させることができる

[0047]

また、保持アーム32A、32Bを略円弧状にスライド移動させるようにしているので、その分、処理装置20Bの搬出入口を小さくでき、例えばここに用い



また、図15~図18に示す実施例では、保持アーム部の先端側が互いに接近 するように配置した場合を示したが、逆に保持アーム部の先端側が大きく離間す るように配置してもよい。

図19はこのような保持アームの配列の第2の変形例を示す斜視図、図20は 図19に示す保持アーム部を用いた処理システムの一例を示す概略構成図である

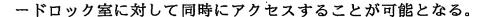
[0048]

図示するように、この実施例の場合には、2つの保持アーム部32A、32Bの先端側を互いに大きく遠ざけるようにして配置している。この場合、図20に示すように共通搬送室16は略正三角形状に成形されており、各辺に処理装置20A、20B、処理装置20C、20D及びロードロック室22A、22Bをそれぞれ隣接させて連結している。そして、この共通搬送室16内の中心に、搬送基台30が回転自在に設置されている。ここで両保持アーム部32A、32Bの延長方向は、図20に示すように互いに隣接する2つの処理装置、例えば処理装置20A、20B同士、処理装置20C、20D同士及びロードロック室22A、22B同士に向かうように設定されている。従って、図20に示すようにこの実施例によれば、異なる処理装置から、或いは異なるロードロック室から同時にウエハWを取り出し、且つこれを別の所に同時に移載することができる。

[0049]

図21は図19に示す保持アーム部を用いた処理システムの他の一例を示す概略構成図である。ここでは、共通搬送室16を横長の六角形状に成形しており、各辺に、処理装置20A、20B、処理装置20C、20D、処理装置20E、20F及びロードロック室22A、22Bをそれぞれ互いに隣り合わせて連結している。そして、この共通搬送室16の中央部に、その長手方向へ水平移動可能な状態で、図19にて説明した搬送基台30を設けている。この搬送基台30を水平移動させる機構は、図1に示す屈伸アーム部28、図10に示す移動台60を中心とする機構のいずれを用いてもよい。

この実施例の場合にも、上記したグループの2つの処理装置、或いは2つの口



[0050]

<関連技術>

次に、本発明の関連技術について説明する。

図22及び図23は本発明の関連技術を説明するための共通搬送室を示す斜視 図である。

一般に、共通搬送室を設計する場合には、処理装置の数量、サイズ、取り付け 位置等の設計条件の決定が必要であり、この設計条件が決定した後に、上記した ような共通搬送室を組み立て、また、その側板に処理装置を取り付けるための開 口加工等を直接施すようにし、この側板に直接的に処理装置等を取り付け固定す るようにしていた。しかし、これでは装置自体を完成するまでに長期間を要して しまう。

[0051]

そこで、この関連技術では、共通搬送室16を区画するケーシング18の側板や天井板等に予め大口径の開口を設けて、これをケーシング18として組み立てておき、そして、このケーシング18の側板や天井板等に、搬出入口が形成されている処理装置取り付け板をボルト等により容易に着脱可能となるように設けるようにする。この処理装置取り付け板は、予め多数用意しておき、各処理装置取り付け板には、板毎に異なったサイズ或いは数の搬出入口を予め設けており、上記設計条件が決定した時点で、それに対応した処理装置取り付け板を用いれば、装置の組み立てを迅速に行うことが可能となる。

[0052]

図22に示す装置例では、図22(A)に示すようにケーシング18の長手方向の側板18A、18B、天井板18C及び長手方向とは反対側の短い側板18Dに、それぞれ予め大きな開口150A、150B、150C、150Dが形成されている。このようなケーシング18は上記設計条件に関係無く予め多数形成されている。そして、図22(B)に示すように上記側板18A、18B、18Dや天井板18Cに、注文等によって設計条件が決定された時にこの設計条件に対応した処理装置取り付け板150をボルト等によって取り付け固定する。



[0053]

図示例では側板18Aに処理装置取り付け板150を取り付けた状態を示す。そして、この処理装置取り付け板150には、処理装置を取り付けるための搬出入口が設けられている。図22(B)に示す場合には、3つの搬出入口152Aが設けられており、各搬出入口152Aに小型の処理装置20X、20Y、20Zが取り付けられている。この種の処理装置取り付け板150は、予め多数枚用意されており、しかも、板毎に搬出入口152Aの数やサイズが異なっており、注文等によって定められる設計条件に応じた処理装置取り付け板150が選択されて用いられる。尚、ここでは天井板18Cにも開口150Cを設けているが、この部分は開口150Cの無い1枚のプレートとしてもよい。

[0054]

図23は透視図を示し、この場合には、ケーシング18の長手方向の一方の側板18Aに、サイズの大きな2つの搬出入口154Aを有する処理装置取り付け板156をボルト等で取り付け固定し、他方の側板18Bに、1つの搬出入口(図示せず)を有する処理装置取り付け板158をボルト等で取り付け固定した場合を示している。そして、上記一方の処理装置取り付け板156には、サイズの大きな2つの処理装置20Cが取り付けられている。

このように、板毎に搬出入口の数やサイズの異なる処理装置取り付け板150 、156、158を予め複数種類用意しておけば、注文に応じて適切なサイズの 搬出入口を有する側板を簡単に且つ迅速に組み付けすることができる。

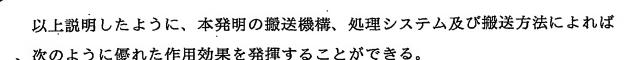
. [0055]

尚、上記共通搬送室の形状は、長方形に限定されず、五角形、或いは六角形以 上でもよい。

また、以上の実施例では被処理体として半導体ウエハWを例にとって説明したが、これに限定されず、ガラス基板、LCD基板等にも本発明を適用することができる。

[0056]

【発明の効果】



請求項1~4、7~16に係る発明によれば、搬送基台に対して保持アーム部を直線的にスライド移動させることにより、被処理体の入れ替えを行うことが可能なので、位置決め精度や繰り返し位置決め精度やスループットを向上できるのみならず、構成が比較的簡単なことから信頼性やメンテナンス性も向上させることができる。

請求項5に係る発明によれば、パーティクルを発生する頻度の高い移動台を収容している部屋の雰囲気が、搬送基台を収容している部屋に流入することを抑制することができる。

請求項6に係る発明によれば、駆動モータ部をケーシングの外側に配置し、この駆動力を歯車機構によって伝達して保持アーム部をスライド移動させることができる。

請求項17に係る発明によれば、搬送機構の搬送基台と保持アーム部とを同時 に動かすようにしたので、被処理体の搬送操作を迅速に行うことができ、その分 、スループットを向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の搬送機構の第1の実施例を用いた処理システムの一例を示す概略構成 図である。

【図2】

搬送機構の第1の実施例を示す拡大斜視図である。

【図3】

搬送機構の第1の実施例を示す内部構成図である。

【図4】

搬送送機構の第1の実施例の動作の一例を示す図である。

【図5】

半導体ウエハWの入れ替え操作の第1の変形例の一部を示す図である。

【図6】



半導体ウエハの入り替え操作の第2の変形例の一部を示す図である。

【図7】

支持アーム部の駆動系の変形例の一部を示す斜視図である。

[図8]

略正六角形状の共通搬送室の周囲に4つの処理装置を設けた処理システムを示す図である。

【図9】

搬送機構の第2の実施例を用いた処理システムの一例を示す概略構成図である

【図10】

搬送基台と移動台との取り付け状態を示す図である。

【図11】

半導体ウエハの入れ替え操作時の動作を示す図である。

【図12】

搬送機構の第3の実施例を示す分解斜視図である。

【図13】

歯車機構の連結状態を模式的に示す図である。

【図14】

スプライン軸と歯車との関係の一例を示す図である。

【図15】

保持アーム部の配列の第1の変形例を示す斜視図である。

【図16】

保持アーム部を用いて半導体ウエハの入れ替えを行う場合の工程を示す図である。

【図17】

本発明の搬送機構の第4の実施例を示す分解斜視図である。

【図18】

図17に示す保持アーム部を用いて半導体ウエハの入れ替えを行う場合の工程 を示す図である。

【図19】

保持アームの配列の第2の変形例を示す斜視図である。

【図20】

保持アーム部を用いた処理システムの一例を示す概略構成図である。

【図21】

図19に示す保持アーム部を用いた処理システムの他の一例を示す概略構成図である。

【図22】

本発明の関連技術を説明するための共通搬送室を示す斜視図である。

【図23】

本発明の関連技術を説明するための共通搬送室を示す斜視図である。

【符号の説明】

- 2 処理システム
- 16 共通搬送室
- 18 ケーシング
- 20A~20F 処理装置
- 22A~22B ロードロック室
- 26 搬送機構
- 28 屈伸アーム部
- 30 搬送基台
- 32A, 32B 保持アーム部
- 36A, 36B アーム駆動モータ部
- 36C 基台駆動モータ部
- 4.2 A, 42 B 案内レール
- 44A, 44B ボールネジ
- 60 移動台
- 62 連結軸
- 62A 中軸
- 62B 中間軸

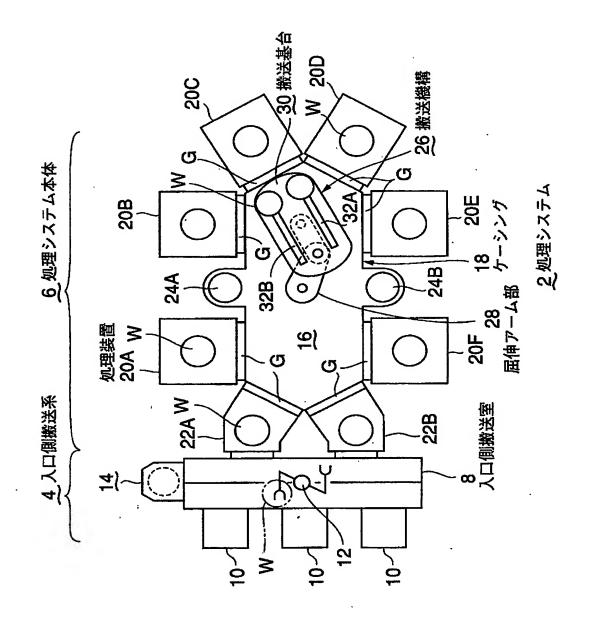
- 62C 外軸
- 68A 上側の空間・
- 68B 下側の空間
- 80 第1の歯車機構
- 82 第2の歯車機構
- 84A~84C スプライン軸
 - W 半導体ウエハ (被処理体)



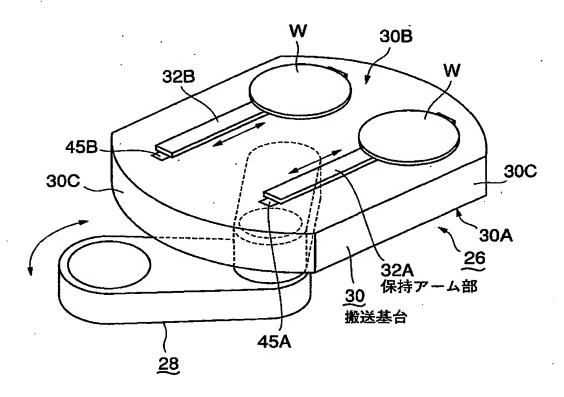
【書類名】

図面

【図1】

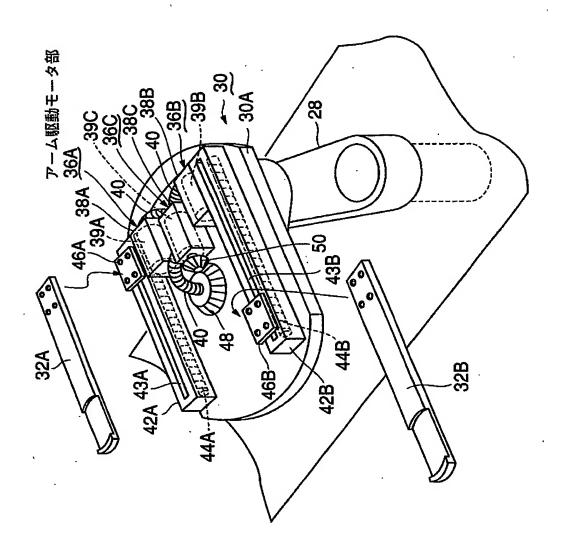




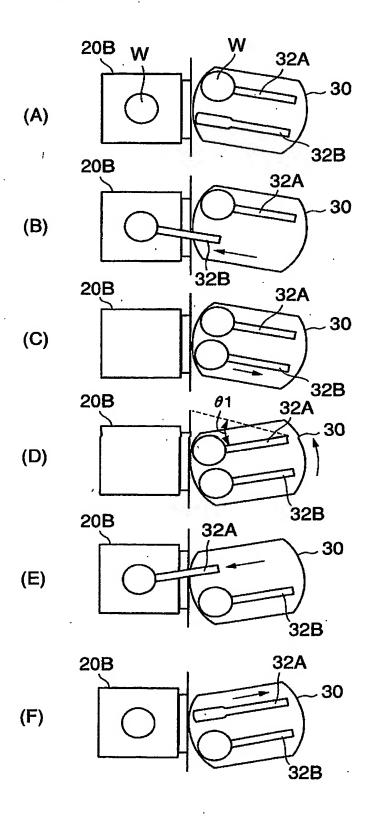


<第1の実施例>

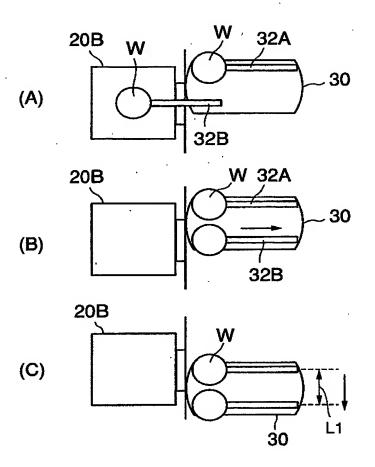




【図4】

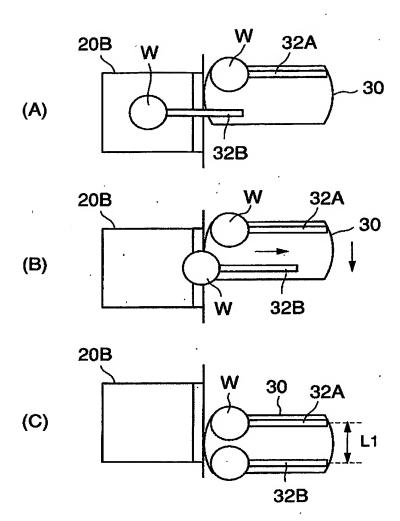


【図5】



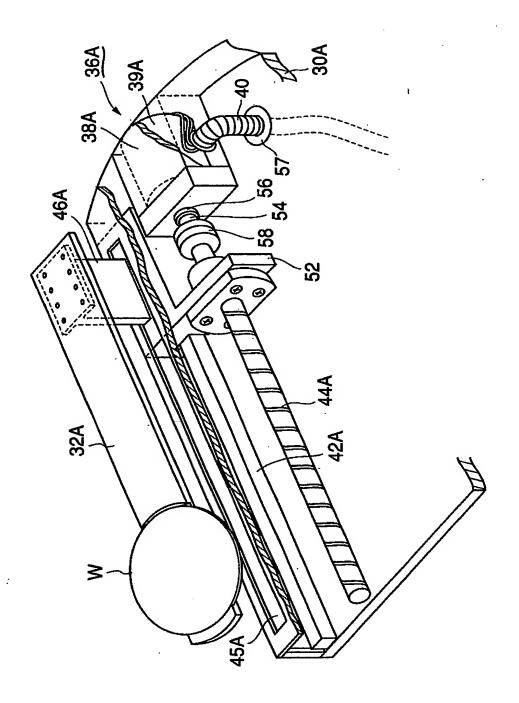
<ウエハ入れ替えの第1の変形例>

【図6】

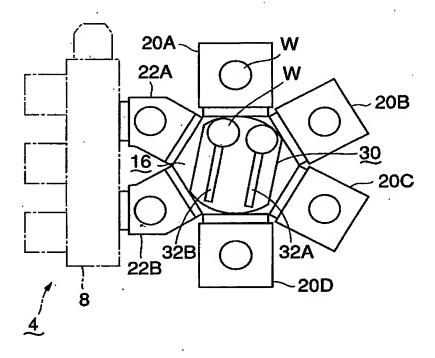


<ウェハ入れ替えの第2の変形例>

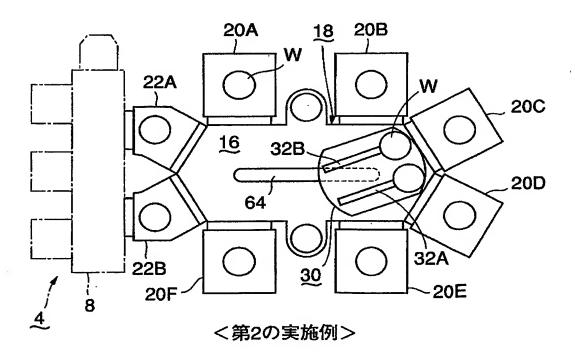




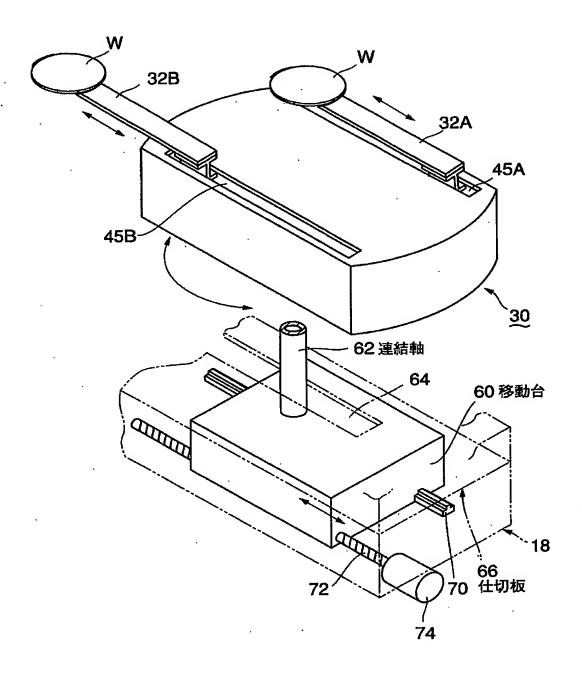
【図8】



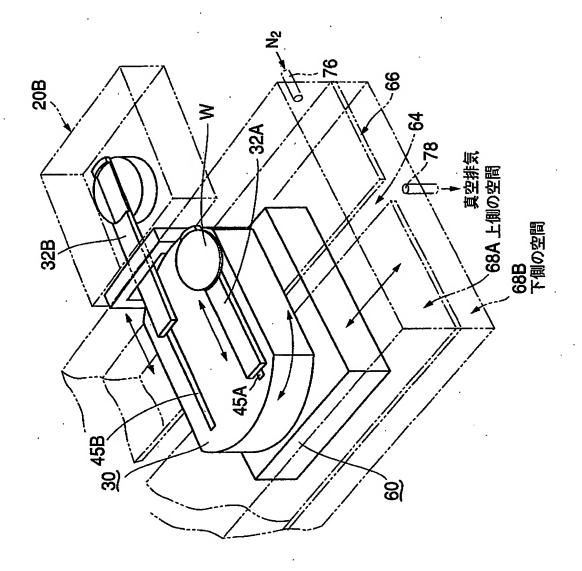
【図9】



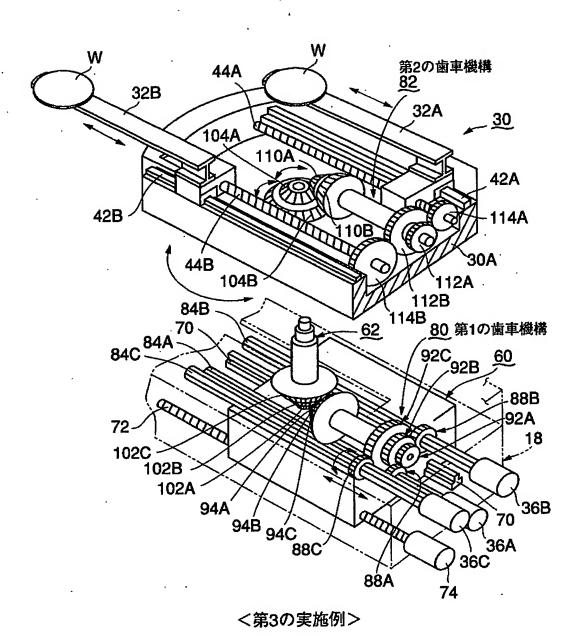






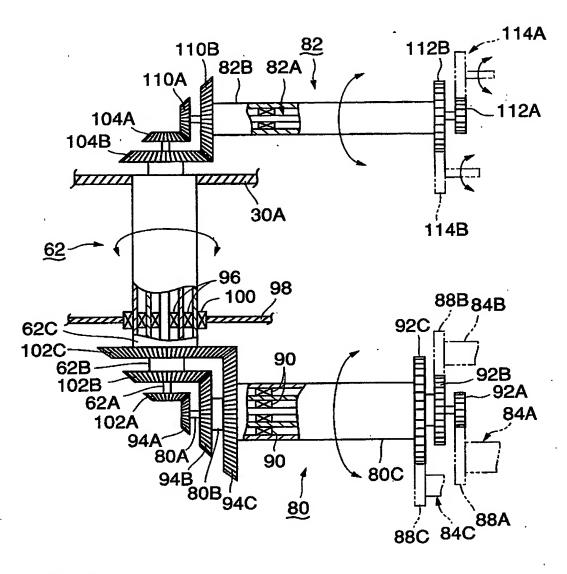


【図12】

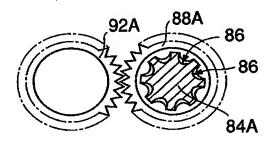


出証特2002-3092510

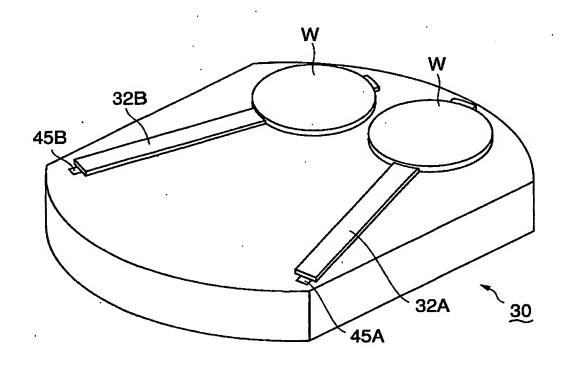




【図14】

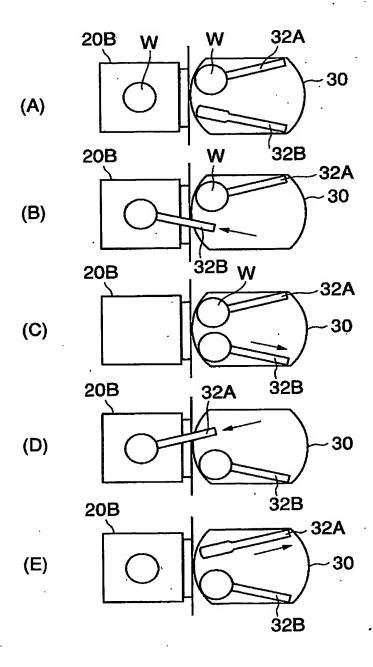




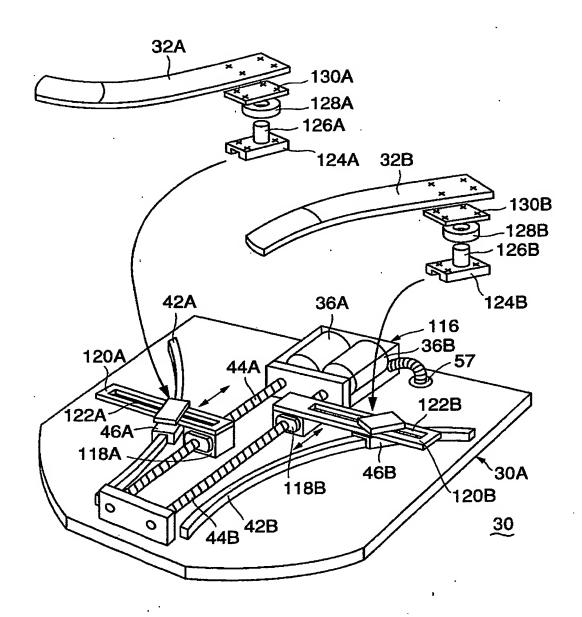


<保持アーム部の第1の変形例>

【図16】

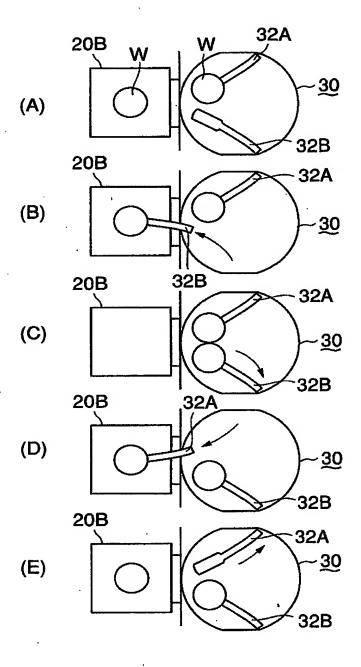




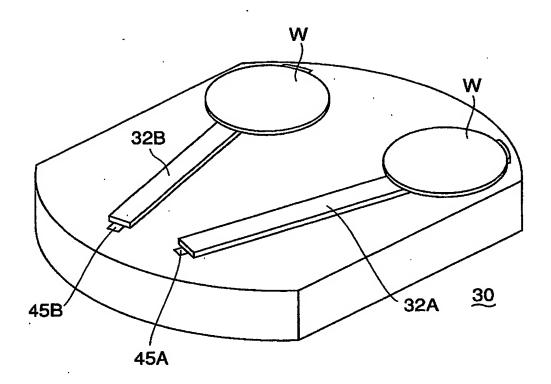


<第4の実施例>

【図18】

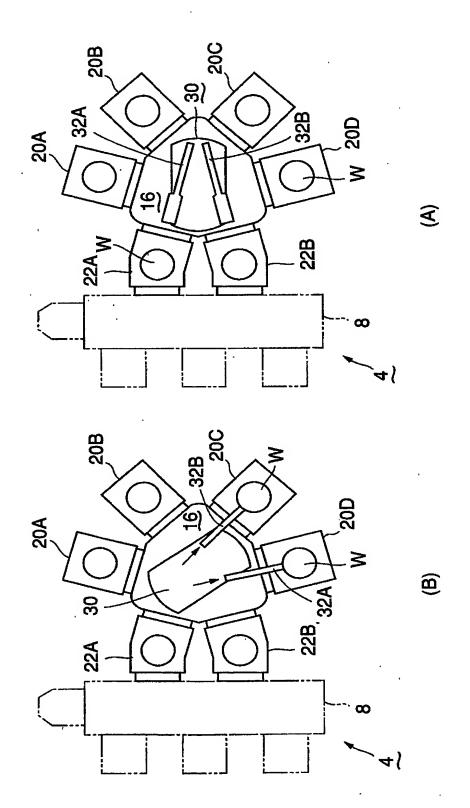




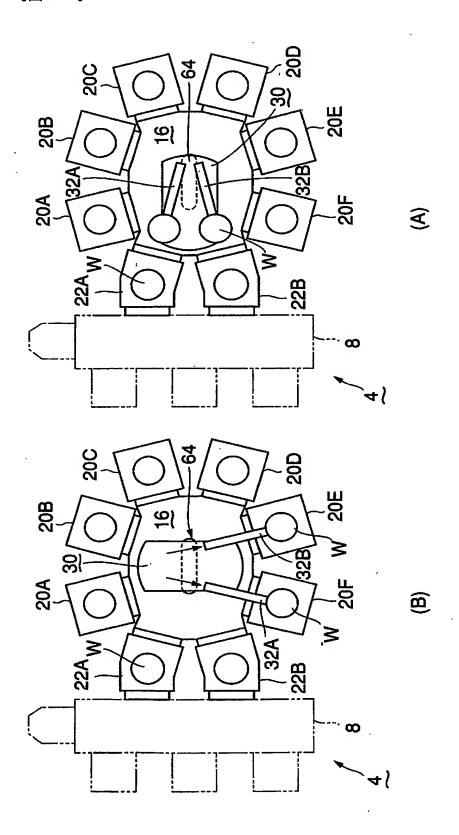


<保持アーム部の第2の変形例>



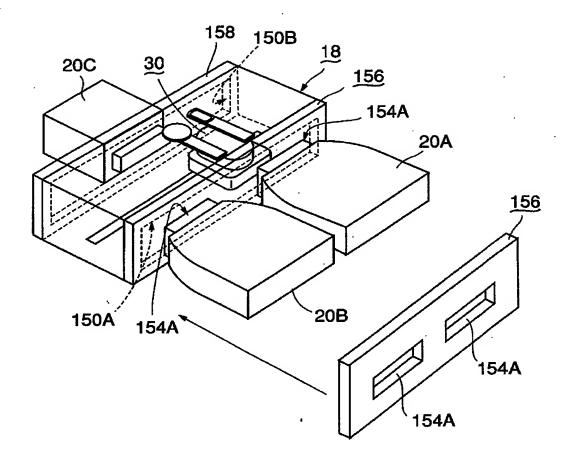














【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 屈伸運動や旋回運動を極力排除して、位置決め精度や繰り返し位置決め精度等を向上させることが可能な搬送機構を提供する。

【解決手段】 被処理体Wに対して所定の処理を施す処理装置20A~20Fへ前記被処理体を搬送するための搬送機構において、搬送基台30と、前記搬送基台上に、実質的に同一平面上で且つ実質的に同一方向へ出没できるようにスライド可能に設けられると共に、先端部で前記被処理体を保持する複数の保持アーム部32A,32Bと、を備える。これにより、屈伸運動や旋回運動を極力排除して、位置決め精度や繰り返し位置決め精度等を向上させる。

【選択図】 図1



認定・付加情報

特許出願の番号

特願2002-001831

受付番号

50200012884

書類名

特許願

担当官

第五担当上席

0094

作成日

平成14年 1月15日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成14年 1月 8日



出願人履歴情報

識別番号

[000219967]

1. 変更年月日 1994年 9月 5日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都港区赤坂5丁目3番6号

氏 名 東京エレクトロン株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
	☐ BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.